

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第1区分

【発行日】令和4年11月14日(2022.11.14)

【国際公開番号】WO2021/157685

【出願番号】特願2021-575877(P2021-575877)

【国際特許分類】

C 1 2 N 5/0783(2010.01)

C 1 2 N 5/10(2006.01)

【F I】

C 1 2 N 5/0783

C 1 2 N 5/10

10

【手続補正書】

【提出日】令和3年8月24日(2021.8.24)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

20

【特許請求の範囲】

【請求項1】

CTLの抗原エピトープのHLA拘束性のクラスI及びHLA-EのHLAクラスIを発現する、ヒトT細胞由来iPS細胞由来の細胞傷害性T細胞であって、CTLの抗原エピトープのHLA拘束性のクラスI分子が、HLA-A24又はHLA-A02である、ヒトT細胞由来iPS細胞由来の細胞傷害性T細胞。

【請求項2】

(削除)

【請求項3】

ヒトT細胞由来のiPS細胞のHLAクラスIをすべてロックアウトする工程、HLAクラスIがすべてロックアウトされたT-iPS細胞にCTLの抗原エピトープのHLA拘束性のHLAクラスI及びHLA-Eの遺伝子を導入する工程、並びに前記遺伝子導入されたT-iPS細胞をCD8シングルポジティブT細胞に再分化する工程、を含むことを特徴とする、CTLの抗原エピトープのHLA拘束性のクラスI及びHLA-Eの2種のHLAクラスIを発現する、ヒトT細胞由来iPS細胞由来の細胞傷害性T細胞の製造法であって、CTLの抗原エピトープのHLA拘束性のクラスI分子が、HLA-A24又はHLA-A02である、ヒトT細胞由来iPS細胞由来の細胞傷害性T細胞の製造法。

30

。

40

50